



**Agency Contact:**

David Moreno

**MCA**

Tel: +1-650-968-8900, ext. 125

E-mail: [dmoreno@mcapr.com](mailto:dmoreno@mcapr.com)

リソグラフィー業界の著名人 Dr. Leo Pang が D2S 社に Chief Product Officer として参加

SAN JOSE, Calif., May 12, 2014-電子ビームと汎用画像処理ユニット ( GPGPU ) 技術基礎としたコンピュータベースの設計プラットフォーム供給メーカーである D2S®社は、本日、半導体業界の著名人で Luminescent Technologies 社の前シニアエグゼクティブであった Dr. Linyong (Leo) Pang 氏が Chief Product Officer および上級副社長 ( executive vice president ) として加わったとアナウンスした。ソフトウェア、半導体および電子設計自動化 ( EDA ) 領域で 15 年以上の経験を持つ Dr. Pang は、先端半導体および先端フォトマスク製造への EDA 製品拡大を計画する D2S 社にて、製品開発を担当する。

「弊社を代表し、Leo 氏の弊社への参加を歓迎します。リーダーシップ、革新性およびビジネス感覚をバランスよく持つ Leo 氏が我々のチームに加わることは誠に喜ばしい事です」と D2S 社 CEO の Aki Fujimura 氏は述べた。「Leo 氏は、inverse lithography 技術 (ILT) を含めフォトマスクおよび露光プロセスの最適化を行う革新的な製品を開発したという非常に強い経験を持ち、お客様がご要求をされる以上に、必要とされるものを深く認識する稀な能力を有し、業界に新たな貢献をするために、その認識されたものをコンピュータ技術で実現させる能力をお持ちです。半導体製造業界に先端ソフトウェア製品を提供するため、Leo 氏は D2S 社の戦略策定をリードするに最も適した人物です」

「製品開発を率いる役割で D2S 社に参加する事ができることをとても楽しみにしております」と Dr. Pang は述べた。「半導体製造の世界はハードウェアと設備の限界に近づき、計算とソフトウェアでの最適化にて更なる改善がなされる時代に入ってきております。

Luminescent 社では 10 年ほど前から露光技術の改善手法として ILT の開発を進め、更に、微細化し複雑化する ILT マスクパターンの歩留り最適化の課題に対処するため、計算機計測と検査技術の開発を進めました。今回、D2S 社では、再度ソフトウェアと計算機技術にて、リーズナブルな描画時間と良好なパターン精度にて複雑なマスクの描画行うという挑戦の機会を頂きました。」

## **D2S HIRES INDUSTRY VETERAN LEO PANG AS CHIEF PRODUCT**

### **OFFICER.....Page 2 of 2**

D2S 社に加わる前、Dr. Pang は Luminescent Technologies 社に 10 年在籍し、重役として製品開発を中心に、顧客/営業やマネジメントなどを経験。Dr. Pang はマスクシヨップやウエハ工場にて広く受け入れられた業界初のフルチップ ILT 製品、source mask 最適化製品、および、業界初の計算機計測と検査製品の開発にて重要な役割を担いました。

Luminescent Technologies 社の前、Dr. Pang は Synopsys 社、Numerical Technologies 社などを含むいくつかの先端半導体技術関連の企業に在籍。Dr. Pang は University of Science and Technology of China (USTC) の応用機械学科 ( mechanical engineering ) の学士号と修士号を、また、Stanford 大学のコンピュータ科学学科の修士号および応用機械学科の博士号を有します。

## About D2S, Inc.

D2S は既存 eBeam 技術を最大限に利用し、少量生産および大量生産に対するマスク製造コストを削減するためのコンピュータベースの設計プラットフォームを供給するメーカーです。D2S TrueMask® ソリューションは、ウエハ高品質確保のために必要とされる複雑な形状を、既存の eBeam マスク描画装置を利用し、コスト効果高い描画時間で、28nm もしくはそれ以降の世代の先端フォトマスクの製造を可能とする製品です。D2S は eBeam Initiative の事務局を担っています。本社はカリフォルニア州サンノゼ市にあり、2007 年に創業しております。詳細に関しましては、: [www.design2silicon.com](http://www.design2silicon.com) を参照ください。

###

D2S と D2S のロゴは、D2S, Inc.の登録商標です。TrueMask と TrueModel は D2S, Inc.の商標です。